چکیدہ

ما یک فیلتر کامل دره (ولی) – اسپین و دره در سیلیسین تحت کرنش پیشنهاد میکنیم. این ناشی از پتانسیل برداری مؤثری است که بواسطه کرنش در سیلیسین ایجاد می شود. علاوه برآن، ما یافتیم که قطبش اسپین– دره کامل در سیلیسین تحت کرنش می تواند در حضور میدان الکتریکی عمودی و بدون میدان تبادلی ایجاد شود. همچنین ما نشان دادیم که دره فیلترینگ و دره– اسپین فیلترینگ به راستای کرنش اعمال شده در حضور میدان الکتریکی عمودی و باسته است، در اینجاد راستای قطبش اسپینی الکترونها برای درههای کل و کل می تواند به آسانی توسط میدان الکتریکی عمود است که بواسطه کرنش در اینجا،

Controllable spin and valley transport in strained silicene

Farokhnezhad, Mohsen¹; Esmaeilzadeh, Mahdi¹

¹ Department of Physics, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

Abstract

We propose a perfect valley-spin and valley filter in strained silicene. This is due to effective vector potential which induced by strain in silicene. In addition, we found that perfect spin-valley polarization can be created in the presence of perpendicular electric field and without exchange field. We also show that valley and valley-spin filtering depends on the direction applied tension in the presence of perpendicular electric field. Here, the spin polarization direction of electrons for valleys K and K' can easily be controlled by an electric field normal to plane of strained silicene.

PACS No: 75.76. +i

اسپینی طولانی دارند که با گرافین در دمای اتاق قابل مقایسه است[۳]. علاوه بر آن، سیلیسین سازگاری زیادی با صنعت نیم رسانا دارد که امروزه آن بطور زیادی به سیلیکون وابسته است. اثر کرنش یک روش مهم برای تنظیم کردن خواص الکترونیکی از طریق تغییر دادن گاف نواری در ساختارهای سیلیکونی است. سیلیسین در شرایط ایده آل میتواند به میزان ۲۰ درصد کشیده شود و آن به دلیل داشتن شکستگی در ساختارش، انعطاف پذیر تر از گرافین است[٤]. اثر کرنش در سیلیسین معادل وارد کردن پتانسیل برداری مؤثر با علامتهای متفاوت برای دو دره ی Xو X در هامیلتونی دیراک است. در واقع در این حالت الکترونها در دو دره ی X و X یتانسیل های متفاوتی را تجربه میکند.

سیلیسین، یک شبکه لانه زنبوری دو بعدی از اتمهای سیلیکون است که در سالهای اخیر به دلیل خواص الکترونیکی جالب مورد توجه قرار گرفته است. سیلیسین با داشتن هندسه مشابه با گرافین، دارای خواص الکترونیکی مشابه از جمله دارا بودن الکترونهای دیراک با تحرک پذیری بالا و طیف انرژی خطی در تراز فرمی است. در این ساختار یک شکستگی به دلیل شعاع یونی زیاد سیلیکون رخ می دهد بطوری که اتمهای دو زیر شبکه در دو صفحه به فاصله ۳ ۸۲۰۱۰ قرار گرفتهاند[۱]. مهمترین کاربرد این ویژگی آن است که گاف نواری و حالتهای قطبیده اسپینی با میدان الکتریکی می تواند به راحتی تنظیم شود[۲]. حاملهای بار در نانومواد سیلیکونی زمان واهلش اسپینی و طول همدوسی

مقدمه

حضور میدان الکتریکی، هامیلتونی مؤثر انرژی پایین نزدیک درهای K و K به صورت زیر می تواند توصیف شود[۱]. $H = v_F(\hbar k_x + e\tau A_x)\sigma_x - \tau v_F(\hbar k_y + e\tau A_y)\sigma_y$ (۱) $-\tau\sigma\lambda_{so} + \Delta\sigma_z eE_z$ σ_i میباشد و K(K') میباشد و $\tau = +(-)$ میباشد و $\sigma = \pm 1$ متناظر با درههای K(K') میباشد و $\sigma = \pm 1$ ماتریسهای پائولی شبه اسپینی و $1 \pm \sigma$ $\delta_{so} = \pi/4$ meV قدرت اندیسهای اسپینی هستند. در اینجا v_F سرعت فرمی برهم کنش اسپین مدار ذاتی است. در اینجا v_F سرعت فرمی است. χ_a و χ_a پرانسیلهای برداری مؤثر در راستاهای X و Y



شکل ۱: صفحه سیلیسین که به سه ناحیه نرمال/تحت کرنش/نرمال تقسیم شده است. ناحیه تحت کرنش به طول L میباشد که کرنش تک محوره در راستای زیگزاگ و آرمیچر به آن اعمال میشود.

میباشند که بخاطر کرنش در دو درهی K و 'K ایجاد می شوند. در اینجا این پتانسیلهای برداری مؤثر در سیلیسین مشابه با گرافین مطابق با مراجع [۸،۵] بصورت زیر بدست می آیند: (۲)

$$ev_F A_x = \frac{5\rho t_0}{4(1 + \cot^2(\varphi))} (\varepsilon_{11} - \varepsilon_{22})$$

$$ev_F A_y = \frac{3\beta t_0}{4(1 + \cot^2(\varphi))} (2\varepsilon_{12})$$
(^(r))

در اینجا $t_0 = 1/7 \text{ eV}$ و $\varphi = 1 \cdot 1/7 e$ زاویه بین ثابت شبکه و $t_0 = 1/7 \text{ eV}$ زارمتر محور Z در شبکه سیلیسین میباشد. همچنین $\pi \approx \beta$ یک پارامتر ثابت است. $g \approx \epsilon_{12}$ و ϵ_{12} مؤلفه های تانسور کرنش بصورت زیر میباشند[۸]:

$$\varepsilon_{11} = \varepsilon \left(\cos^2 \theta - \nu \sin^2 \theta \right) \tag{(1)}$$

بطوری که در گرافین پتانسیل برداری مؤثر وابسته به دو درهی K و / لم بوسیله کرنش در گرافین، می تواند برای فیلتر ولی(دره) بکار رود[٥]. برخلاف گرافین، اثر برهم کنش اسپین مدار ذاتی در سیلیسین موجب ترابرد وابسته به اسپین و جفت شدگی بین درجه آزادی دره و اسپین در ترابرد الکترونی می شود. بنابراین سیلیسین پتانسیل زیادی برای تولید جریانهای قطبیده اسپین- دره دارد[7]. همچنین یک فیلتر دره- اسپین با سد دوگانه مغناطیسی در سیلیسین تحت کشش با بازده ۹۰٪ طراحی شده است[7]. فیلتر اسپین – دره پیشنهادی آنها با راستای کشش اعمال شده قابل کنترل نبود و از فرومغناطیس و کرنش بطور همزمان استفاده شده بود. اما در این مقاله بدون استفاده از فرومغناطیس وتنها با استفاده از کرنش توانستیم فیلتر کامل اسپین – دره و دره داشته باشیم که با راستای کشش اعمال شده نیز قابل کنترل است. علاوه بر آن، قطبش اسيين – دره الكترونها با راستاي ميدان الكتريكي عمودي قایل تنظیم است. اخیراً محققان یک ابر شبکه سیلیسینی با نواحی کرنش و بدون کرنش در نظر گرفتند و اسپین – دره فیلتر کامل را درآن مشاهده کردند[۷]. در آنجا اثر پتانسیل برداری ناشی از کرنش به صورت یک پارامتر ثابت فرض شده بود و اثر کرنش بر روی پارامتر شکستگی در آن بررسی نشده بود. اما در این مقاله، ما معادلات پتانسیل برداری ناشی از کرنش را بصورت تحلیلی استخراج كرديم كه وابسته به تانسور كرنش است. اين منجر می شود که پتانسیل برداری به راستای کرنش اعمال شده بستگی داشته باشد ومنجر به يک فيلتر اسيين – دره قابل کنترل شود.

تئوری و روش محاسباتی

ما یک صفحه سیلیسین با یک ناحیه تحت کرنش مطابق شکل ۱ در نظر میگیریم. ما از برهم کنش اسپین مدار راشبا بخاطر ناچیز بودن آن در مقایسه با برهم کنش اسپین مدار ذاتی و پارامترهای دیگر صرفنظر میکنیم. در اینجا طول ناحیه تحت کرنش در امتداد راستای زیگزاگ ۱۱۳ mL و برای کرنش در امتداد راستای آرمیچر L=۱۱۹ m میباشد. برای سیلیسین تحت کرنش و در

$$\varepsilon_{22} = \varepsilon \left(\sin^2 \theta - v \cos^2 \theta \right) \tag{6}$$

$$\varepsilon_{12} = \varepsilon \left((1+\nu)\sin\theta\cos\theta \right) \tag{7}$$

در اینجا θ زاویه بین راستای کرنش و خط موازی راستای زیگزاگ است. بطوریکه برای کرنش در امتداد راستای زیگزاگ \cdot = θ و برای کرنش در امتداد راستای آرمیچر $\frac{\pi}{2} = \theta$ میباشد. $\bullet = \theta$ و برای کرنش در امتداد راستای آرمیچر $\frac{\pi}{2} = \theta$ میباشد. همچنین $\cdot 0^{-1} = 0$ ضریب پواسون در سیلیسین و 3 قدرت کرنش است. ترم آخر در معادله (۱) اختلاف پتانسیل دو زیر شبکه A و B در سیلیسین تحت کرنش میباشد. در اینجا E_z میدان الکتریکی عمودی و g بار الکترون است. Δ پارامتر شکستگی در حضور کرنش است که با استفاده از مرجع [۸] بصورت زیر استخراج میشود.

$$\Delta = (1 - \nu \varepsilon) \Delta_0 \tag{(V)}$$

در اینجا Δ₀ = ۰/۰٤٦ nm پارامتر شکستگی در غیاب کرنش میباشد. با بکاربردن هامیلتونی معادله (۱) ما میتوانیم ویژه مقادیر انرژی را به صورت زیر محاسبه کنیم.

$$E = \pm \sqrt{(\hbar v_F k)^2 + (\tau \sigma \lambda_{SO})^2} =$$

$$\pm \sqrt{(\hbar v_x k_x' + e \tau_x v_F A_x)^2 + (\hbar v_y k_y + e \tau v_F A_y)^2 + \Delta_s^2} \qquad (A)$$

توابع موج برای دره τ و اسپین σ در نواحی نرمال و تحت کرنش میتواند بصورت زیر توصیف شود.

$$\psi_{I}(x) = \frac{1}{\sqrt{2E(E + \tau\sigma\lambda_{SO})}} e^{ik_{x}x} \begin{pmatrix} \hbar v_{F}k_{+} \\ E + \tau\sigma\lambda_{SO} \end{pmatrix}$$
$$+ \frac{r}{\sqrt{2E(E + \tau\sigma\lambda_{SO})}} e^{-ik_{x}x} \begin{pmatrix} \hbar v_{F}k_{-} \\ E + \tau\sigma\lambda_{SO} \end{pmatrix} \qquad x < 0,$$
$$\psi_{T}(x) = a_{e}e^{ik_{x}x} \begin{pmatrix} E_{+} \\ E_{+} \end{pmatrix} + b_{e}e^{-ik_{x}x} \begin{pmatrix} E_{-} \\ E_{-} \end{pmatrix} \qquad 0 < x < L,$$

$$\psi_{II}(x) = a_{S}e^{ik_{x}x} \begin{pmatrix} z \\ E_{S} \end{pmatrix} + b_{S}e^{-ik_{x}x} \begin{pmatrix} z \\ E_{S} \end{pmatrix} = 0 < x < L,$$

$$\psi_{III}(x) = \frac{t}{\sqrt{2E(E + \tau\sigma\lambda_{SO})}}e^{ik_{x}x} \begin{pmatrix} \hbar\nu_{F}k_{+} \\ E + \tau\sigma\lambda_{SO} \end{pmatrix} \qquad x > L,$$

احتمال عبور وابسته به دره از طریق رابطه زیر محاسبه می شود.

$$T_{K^0} = T_{K^0}^{\uparrow} + T_{K^0}^{\downarrow}$$
 (۱۰)

نتايج و بحث

برای همه محاسبات، بر هم کنش اسپین مدار ذاتی بهنجار شده، بصورت ۰/۰ $E = \lambda_{SO}/E = 3$ انتخاب میشود. در شکل ۲ ضریب عبور بر حسب زاویه فرود الکترون رسم شده است. با توجه به شکل ۲-الف با اعمال کرنش در راستای زیگزاگ (•= θ) یک دره فیلتر تقریباً کامل روی داده است. بطوری که تنها الکترونها با دره X از سیستم عبور میکنند. در زیر شکل ۲-الف همچنین در غیاب کرنش (• = ٤) $T_K = T_K$ است. با اعمال کرنش در راستای آرمیچر $\frac{\pi}{2} = \theta$ (شکل ۲-ب) تنها الکترونها با دره K از سیستم عبور میکنند. دا زیر م



شکل ۲ : الف) ضریب عبور الکترون ها بر حسب زاویه فرودی الکتـرون بـرای کرنش در راستای زیگزاگ ب) در راستای آرمیچر

در شکل ۳ ما ضریب عبور الکترون را برحسب میدان الکتریکی بهنجار شده در یک زاویه فرود ثابت الکترون π ۰/۳۰٤ = ϕ رسم کردیم. همانطور که در شکل ۳-الف مشاهده می شود، در حضور میدان الکتریکی یک فیلتر کامل اسپین – دره داریم بطوریکه تنها الکترونها با دره '*K* و با اسپین (بالا یا پایین) از سیستم عبور میکنند که این بخاطر از بین رفتن تقارن وارونی فضایی سیستم است. علاوه بر این، با تغییر راستای میدان الکتریکی در امتداد محور z از 2^{+} به 2^{-} راستای اسپین الکترونهای عبوری از پایین به بالا قابل تنظیم است. همچنین این اتفاق برای دره *K* برای کرنش در امتداد آرمیچر $\frac{\pi}{2} = \theta$ در شکل فیلتر دره – اسپین به کمک کرنش و میدان الکتریکی عمودی قابل فیلتر دره – اسپین به کمک کرنش و میدان الکتریکی عمودی قابل



شکل ۳ : ضریب عبور اسپین- دره در یک زاویـه فـرود ثابـت برحسب میدان الکتریکی عمودی برای کرنش الف) در راستای زیگزاگ ب) در راستای آرمیچر

ما نشان دادیم که جداشدگی دره در سیلیسین می تواند در مقادیر خاص زاویه فرودی در حضور کرنش اتفاق بیفتد بطوریکه سیلیسین می تواند به عنوان یک فیلتر کامل دره ، عمل کند. در اینجا راستای دره فیلتر با راستای کرنش اعمال شده در سیلیسین قابل تنظیم است. همچنین سلیسین تحت کرنش در حضور میدان الکتریکی می تواند به عنوان یک ابزار تولید کننده جریان قطبیده کامل اسپین – دره عمل کند که راستای قطبش اسپینی با راستای میدان الکتریکی عمودی قابل کنترل است.

مراجع

[1] C.-C. Liu, H. Jiang, and Y. Yao, "Low-energy effective Hamiltonian involving spin-orbit coupling in silicene and two-dimensional germanium and tin," *Physical Review B*, vol.84 ,p. 195430, 2011.

[2] N. Drummond, V. Zolyomi, and V. Fal'Ko, "Electrically tunable band gap in silicene," *Physical Review B*, vol. 85, p. 075423, 2012.

[3] C. Xu, G. Luo, Q. Liu, J. Zheng, Z. Zhang, S. Nagase, *et al.*, "Giant magnetoresistance in silicene nanoribbons," *Nanoscale*, vol. 4, pp. 3111-3117, 2012.

[4]R. Qin, C.-H. Wang, W. Zhu, and Y. Zhang, "First-principles calculations of mechanical and electronic properties of silicene under strain," *Aip Advances*, vol. 2, p. 022159, 2012.

[5] M. R. Masir, D. Moldovan, and F. Peeters, "Pseudo magnetic field in strained graphene: revisited," *Solid State Communications*, vol. 175, pp. 76-82, 2013.

[6] C. Yesilyurt, S. G. Tan, G. Liang, and M. B. Jalil, "Efficient dual spin-valley filter in strained silicene," *Applied Physics Express*, vol. 8, p. 105201, 2015.

- [7] W. Sa-Ke and W. Jun, "Spin and valley filter in strain engineered silicene," *Chinese Physics B*, vol. 24, p. 037202, 2015.
- [8] V. M. Pereira, A. C. Neto, and N. Peres, "Tight-binding approach to uniaxial strain in graphene," *Physical Review B*, vol. 80, p. 045401, 2009.